

a 2004 0097

Invenția se referă la tehnologia semiconductoarelor, în particular la procedee de obținere a suprafeței poroase a semiconductorului.

Esența invenției constă în faptul că pe suprafața semiconductorului se depune o mască ce o acoperă selectiv și se efectuează corodarea electrochimică. Noutatea invenției constă în faptul că masca este executată din fotorezist.

Revendicări: 1

Figuri: 1